

$\hbar\Omega \approx 59$ мэВ) и LA вблизи X ($\hbar\Omega \approx 47$ мэВ). Соответственно минимум вблизи 50 мэВ можно отнести к $LA(X)$ -рассеянию в состояние $1S(A_1)$, а минимум вблизи 62 мэВ — к $L\bar{O}(\Gamma)$ -рассеянию в $1S(A_1)$ и $LA(X)$ -рассеянию в $1S(E)$ или $1S(T_2)$.

При небольшой концентрации Ge в твердом растворе порог примесной полосы несколько уширяется по сравнению с собственно кремнием (рис. 1, спектры 1, 2) за счет возникновения неупорядоченности кристаллической решетки. При дальнейшем увеличении концентрации Ge наблюдается относительное снижение фотоответа в области $40 \div 50$ мэВ вблизи порога, что, по-видимому, отражает уменьшение времени жизни за счет рассеяния, связанного с химической и структурной неупорядоченностью кристалла твердого раствора.

Спектры фотопроводимости исследовались также при различных значениях напряженности электрического поля в образцах (рис. 2). С ростом напряженности электрического поля наблюдаются абсолютный рост сигнала, а также его относительное увеличение в области длинноволнового края примесной полосы, что согласуется с результатами работы [6], где для кремния наблюдалось увеличение вклада более глубоких возбужденных состояний. В нашем случае электрическое поле может оказывать влияние на уровни в области хвоста плотности состояний, индуцированного неупорядоченностью структуры твердого раствора.

В твердом растворе энергия ионизации примесного центра в строгом смысле не определена. В этом случае можно говорить о средней энергии ионизации [7]. Полученные нами данные (рис. 1) указывают на то, что в исследованном диапазоне составов средняя энергия ионизации донора фосфора изменяется незначительно. Сделаем оценку ожидаемого изменения энергии ионизации донора с составом в приближении эффективной массы. Для оценки необходимых параметров будем использовать подход [8]. Экстраполируя, получим для состава $x=0.39$: $X_{1c}-X_{5s}=4.35$ эВ, $a=5.519$ Å, $\epsilon=12.94$, $m_e=0.201m_0$. Приближение эффективной массы [9] дает $E_D(Si)-E_D(Ge_{0.39}Si_{0.61}) \approx 5.6$ мэВ.

Список литературы

- [1] Пихтин А. Н., Попов В. А., Яськов Д. А. // ФТП. 1969. Т. 3. В. 11. С. 1646—1648.
- [2] Landolt-Börnstein. Numerical Data and Functional Relationship in Science and Technology. V. 17. Physics of Group IV Elements and III—V Compounds / Ed. by O. Madelung. Berlin—Heidelberg—N. Y., 1982.
- [3] Onton A. // Phys. Rev. Lett. 1969. V. 22. N 7. P. 288—289.
- [4] Scott W. // J. Appl. Phys. 1979. V. 50. N 1. P. 472—482.
- [5] Barker A. S., Jr., Sievers A. J. // Rev. Mod. Phys. 1975. V. 47 (Suppl.). P. S1—S179.
- [6] Carver G. P., Nicholas R. J., Portal J. C., Stradling R. J. // Sol. St. Commun. 1977. V. 24. N 1. P. 55—60.
- [7] Бернхт В., Конылов А. А., Пихтин А. Н. // ФТП. 1977. Т. 11. В. 11. С. 2206—2209.
- [8] Конылов А. А. // Sol. St. Commun. 1985. V. 56. N 1. P. 1—6.
- [9] Faulkner R. A. // Phys. Rev. 1969. V. 184. N 3. P. 713—721.

Ленинградский электротехнический институт
им. В. И. Ульянова (Ленина)

Получено 23.04.1990
Принято к печати 27.04.1990

ФТП, том 24, вып. 9, 1990

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ВАРИЗОННЫХ СТРУКТУР $Cd_xHg_{1-x}Te$ В УСЛОВИЯХ МАГНИТОКОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЭФФЕКТА

Болгов С. С., Малютенко В. К., Пиша В. И., Савченко А. П.,
Юнович А. Э.

В [1, 2] нами исследовалось рекомбинационное излучение однородных кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$ в скрещенных электрическом (E) и магнитном (H) полях. В этих условиях под действием силы Лоренца распределение электронно-ды-

рочных пар в кристаллах с собственной проводимостью становится неоднородным (магнитоконцентрационный эффект (МКЭ) [3]). Вблизи грани с малой скоростью поверхностной рекомбинации (s) в зависимости от направления E и H полей происходит увеличение или уменьшение концентрации носителей заряда по отношению к их равновесному значению. При этом со стороны грани с малой s наблюдается положительная либо отрицательная люминесценция в области междузонных переходов.

Настоящая работа посвящена изучению люминесценции вариозонных структур $Cd_xHg_{1-x}Te$ в условиях МКЭ. Образцы для исследований представляли собой эпитаксиальные пленки $Cd_xHg_{1-x}Te$ с собственной проводимостью при комнатной температуре, выращенные на высокоомных монокристаллических подложках CdTe. Толщина пленки с $x=0.23$ составляла 20 мкм, вариозонного переходного слоя — 7 мкм и подложки — 0.5 мм. Образцы имели форму пластины 2×5 мм. Омические контакты напаивались индием со стороны узкозонной пленки на торцевые области пластины.

Как известно, CdTe, HgTe и их твердые растворы обладают одинаковой симметрией структуры и близкими параметрами решетки (различающимися менее чем на 1 %). Это позволяет получать совершенную эпитаксию $Cd_xHg_{1-x}Te$ на подложках CdTe с малой плотностью локальных состояний на границе пленка—подложка и сводить к минимуму рекомбинационные потери.

На рисунке 1 приведены полевые зависимости люминесценции вариозонных структур $Cd_xHg_{1-x}Te$ и монокристаллов $Cd_{0.23}Hg_{0.77}Te$ (5) при $T=295$ К и $H=10$ кЭ. На вставке — схема эксперимента.

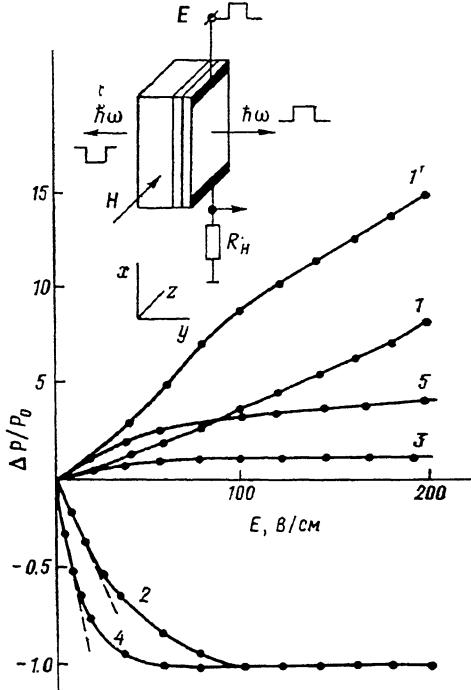


Рис. 1. Полевые зависимости люминесценции вариозонных структур $Cd_xHg_{1-x}Te$ и монокристаллов $Cd_{0.23}Hg_{0.77}Te$ (5) при $T=295$ К и $H=10$ кЭ.

Люминесценция: 1, 1' — положительная, 2, 4 — отрицательная. На вставке — схема эксперимента.

Свободная поверхность пленки либо не обрабатывалась дополнительно после выращивания пленки, либо для увеличения s подвергалась полировке мелким абразивным порошком.

Исследовались вольт-амперные характеристики (ВАХ), а также полевые и спектральные характеристики междузонного рекомбинационного излучения. Измерения проводились при температуре 295 К по методикам, описанным в [4, 5] (схему эксперимента см. на вставке к рис. 1).

Анализ ВАХ показал, что при выносе электронно-дырочных пар под действием силы Лоренца в сторону широкозонной подложки ток имеет большую величину (режим обогащения), чем при дрейфе пар в обратном направлении (режим истощения, эффект достигается изменением направления магнитного поля).

Режим обогащения сопровождается возгоранием положительной люминесценции со стороны подложки, выполняющей роль широкозонного окна (рис. 1, кривая 1), и отрицательной люминесценции со стороны узкозонной пленки (кривая 2). В режиме истощения полярность сигнала люминесценции, наблюдаваемой с каждой из граней образца, изменялась на противоположную в соответствии с изменением знака избыточной концентрации $n-n_i$, в излучающем слое толщиной $\sim 1/a$, где n — концентрация носителей заряда, n_i — концентрация собственных носителей, a — коэффициент поглощения излучения. Кривая 3 (рис. 1) представляет собой полевую зависимость положительной люминесценции, наблюданной со стороны узкозонной пленки.

Максимальное перераспределение носителей в условиях МКЭ реализуется при резкой асимметрии значений s на противоположных широких гранях образца [3]. В исследуемых неоднородных структурах увеличение s на широкозонной подложке путем механической полировки не приводит к изменению ВАХ и полевых зависимостей мощности рекомбинационного излучения (ΔP). В то же время увеличение s на свободной поверхности узкозонной цепочки вызывает гашение как положительной, так и отрицательной люминесценции с этой поверхности и увеличение отношения значений токов в режиме обогащения и истощения. При этом со стороны широкозонной подложки наблюдается резкое по-

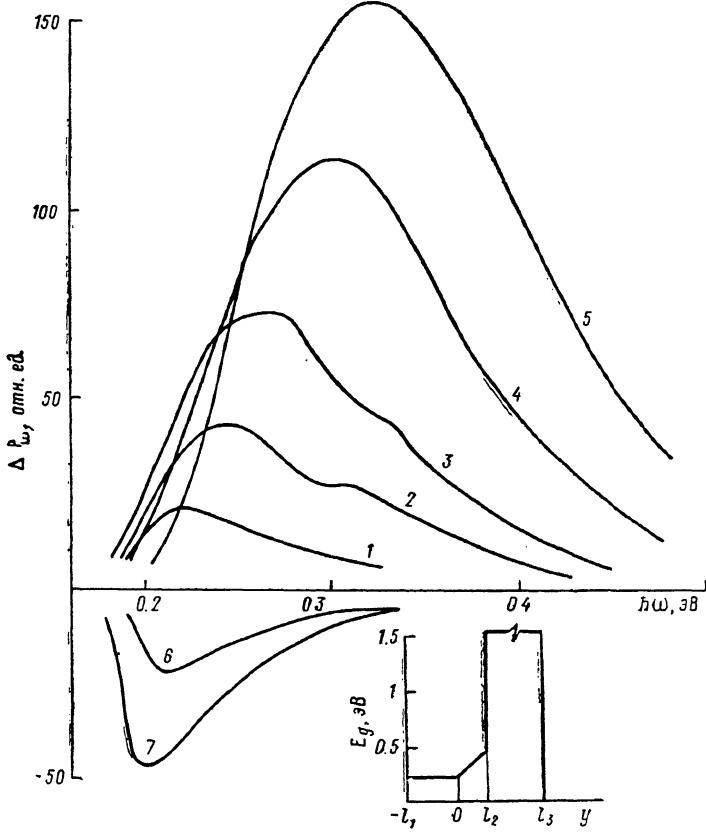


Рис. 2. Спектральные характеристики люминесценции варизонных структур $Cd_xHg_{1-x}Te$ при $T=295$ К и $H=\pm 10$ кэ.

E , В/см: 1, 6 — 20; 2 — 40; 3, 7 — 80; 4 — 160; 5 — 240. На вставке — зависимость E_g структуры от координаты.

вышение мощности рекомбинационного излучения (рис. 1, кривая 1'), а форма полевой зависимости отрицательной люминесценции (в режиме истощения) практически не изменяется (кривая 4).

Анализ спектрального состава люминесценции (рис. 2), наблюдаемой со стороны подложки в режиме обогащения, приводит к выводу, что при выносе электронно-дырочных пар в направлении $\text{grad } E_g$ (E_g — ширина запрещенной зоны) они накапливаются в переходном слое и практически не достигают внешней поверхности подложки: максимум спектра люминесценции в области больших E и H полей смещается в сторону высоких энергий и находится при 0.3—0.4 эВ, тогда, как известно, ширина запрещенной зоны $CdTe$ при 295 К составляет 1.51 эВ.

Для выяснения качественных особенностей МКЭ и люминесценции проведен расчет эффекта в модельной трехслойной структуре, в которой $E_g(y)$ изменяется в переходном слое по линейному закону (см. вставку на рис. 2). Можно показать, что распределение концентрации электронов и дырок [$n(y)=p(y)$] сущес-

ствлено зависит от соотношения между величиной управляющего ($\sim EH$) и встроенного ($\sim dE_g/dy$) полей, т. е. от параметра

$$\psi = \frac{e(\mu_n + \mu_p) EH}{c(dE_g/dy)},$$

где μ_n и μ_p — подвижности электронов и дырок, e — заряд электрона, c — скорость света.

В слабых полях ($\psi < 1$) обогащенная носителями область локализована вблизи $y=0$. С ростом поля $n(0)$ увеличивается, что приводит к росту интенсивности рекомбинационного излучения при практически неизменном положении максимума спектра $\hbar\omega \approx E_g(0)$. В промежуточных полях ($\psi \approx 1$) переходный слой заполняется носителями практически равномерно. Так как при этом локальная мощность спонтанного излучения, пропорциональная $n^2(y)/n_s^2(y)$, увеличивается в направлении $\text{grad } E_g$, максимум спектра сдвигается в высокочастотную область. В сильных полях ($\psi > 1$) n^2/n_s^2 резко возрастает у барьера при $y=l_2$, соответственно максимум спектра люминесценции ΔP_ω сдвигается к энергии $\hbar\omega = E_g(0) + l_2 dE_g/dy$. В промежуточных полях ($\psi \geq 1$) спектр люминесценции ΔP_ω может иметь два максимума. Ослабление низкочастотного излучения с ростом поля объясняется уменьшением концентрации носителей в узкозонной части структуры вблизи $y=0$.

Максимум спектра отрицательной люминесценции при больших значениях E и H полей находится в области частот $\omega = E_g(0)/\hbar$, а весь спектр отрицательной люминесценции приближается к спектру зона-зонного теплового излучения полупроводника.

Проведенные исследования показали, что граница переходного слоя и широкозонной подложки характеризуется эффективной скоростью поверхностной рекомбинации $s \rightarrow 0$. Причем эта область расположена в объеме полупроводника и, что очень важно в практическом отношении, защищена от внешних воздействий. Этот результат является принципиальным при реализации МКЭ и особенно полезным для узкозонных полупроводников, в которых обнаруживается тенденция к возрастанию скорости поверхностной рекомбинации по мере сужения ширины запрещенной зоны [6].

Для сравнения на рис. 1 (кривая 5) показана полевая зависимость положительной люминесценции образца, выполненного из монокристалла $\text{Cd}_{0.23}\text{Hg}_{0.77}\text{Te}$. Все параметры образца были близкими к параметрам эпитаксиальной пленки. Излучение наблюдалось с проправленной грани кристалла. Из рисунка видно, что максимальное отношение $\Delta P/P_0$ (P_0 — мощность отрицательной люминесценции [1]) в однородном образце не превышает 4, в то время как для варизонной структуры оно достигает 15. Такое различие объясняется тем, что в однородных полупроводниках $\text{Cd}_{0.23}\text{Hg}_{0.77}\text{Te}$ даже на свежепроправленной поверхности $s \approx 10^4 \text{ см}/\text{s}$.

Следует также отметить, что вывод излучения со стороны широкозонной подложки приводит к повышению внешнего квантового выхода люминесценции ввиду уменьшения потерь на самопоглощение и отражение от границы полупроводник—внешняя среда. Это связано с уменьшением коэффициента поглощения и показателя преломления в направлении $\text{grad } E_g$ (показатель преломления для $\text{Cd}_{0.23}\text{Hg}_{0.77}\text{Te}$ равен 3.7, а для CdTe — 2.7).

Таким образом, проведенные исследования показали перспективность использования варизонных структур в сочетании с МКЭ для возбуждения люминесценции в узкозонных полупроводниках при высоких температурах. При этом достигается возможность управления спектром люминесценции.

Список литературы

- [1] Малютенко В. К., Яблоновский Е. И., Болгов С. С., Бекетов Г. В., Салюк О. Ю. // ФТП. 1984. Т. 18. В. 2. С. 340—342.
- [2] Болгов С. С., Малютенко В. К., Яблоновский Е. И. // Матер. VII Всес. симп. «Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы». Львов, 1986. Ч. I. С. 69—71.
- [3] Welker H. // Zs. Naturforsch. 1951. Bd 6a. N. 4. S. 184—191.

- [4] Болгов С. С., Малютенко В. К., Пипа В. И. // УФЖ. 1986. Т. 31. В. 2. С. 247—252.
 [5] Золотов С. И., Колесников И. В., Юнович А. Э. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 9. С. 1566—1571.
 [6] Болгов С. С., Малютенко В. К., Пипа В. И., Яблоновский Е. И. // ЖПС. 1986. Т. 45. В. 6. С. 917—921.

Институт полупроводников АН УССР
Киев

Получено 10.01.1990
Принято к печати 4.05.1990

ФТП, том 24, вып. 9, 1990

ФОТОСТИМУЛИРОВАННЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАДИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ МЕЖЗОННОЙ ПОДСВЕТКЕ

Нгуен Хонг Шон

Свето- или радиоэлектрический эффект — появление постоянного тока или разности потенциалов (при разомкнутых контактах) при распространении электромагнитной волны в полупроводниках [1—3]. В классической области частот $\omega < T$ (T — температура решетки в энергетических единицах, $\hbar=1$) этот эффект впервые рассмотрен в [4] и интерпретирован как постоянный холловский ток, возникающий в переменных электрическом и магнитном полях световой волны (высокочастотный эффект Холла). Позже в работах [5, 6] было показано, что наряду с холловским током необходимо учитывать ток, возникающий в результате пространственной дисперсии проводимости, который может быть сравним с холловским током. В квантовой области частот $\omega > T$ этот эффект связан с передачей импульса фотона электрону при поглощении света [2]. В изотропных средах радиоэлектрический эффект является продольным и удовлетворяет соотношению Вайврайха [7]

$$E_z = -E_W, \quad E_W = \alpha(\omega) \sqrt{\epsilon_1} W / enc, \quad (1)$$

где $\alpha(\omega)$ — коэффициент поглощения, W — вектор Пойтинга, $\sqrt{\epsilon_1}$ — показатель преломления, c — скорость света, n — концентрация носителей.

В анизотропных средах наряду с продольным возникает и поперечный (по отношению к W) радиоэлектрический эффект. Конкретной причиной его появления может служить, например, многодолинность зоны проводимости [8] или несферичность изоэнергетических поверхностей [9, 10]. В работах [11, 12] было показано, что поперечный радиоэлектрический эффект существует и в случае, когда анизотропия в среде наводится линейно поляризованной подсветкой (фотостимулированный поперечный радиоэлектрический эффект). В [11, 12] рассматривается случай, когда подсвечивающая волна является внутризонной (энергия ее кванта меньше ширины запрещенной зоны). В данном сообщении будем рассматривать фотостимулированный поперечный радиоэлектрический эффект в другом случае, когда линейно поляризованная подсветка является межзонной. Кроме того, как и в [11, 12], будем ограничиваться случаем классической частоты пробной волны и пренебрегать пространственной дисперсией волн. При этом радиоэлектрический эффект, вызываемый пробной волной, будем рассматривать как высокочастотный эффект Холла. Отметим, что в данной постановке задачи возникновение поперечного радиоэлектрического эффекта обусловлено оптическим выстраиванием импульсов горячих электронов, возбужденных подсветкой в зону проводимости [13]. Влияние такого выстраивания на кинетические и магнитооптические эффекты в полупроводниках исследовалось в [14—18].

Кинетическое уравнение для функции распределения фотоэлектронов, возбужденных из валентной зоны в зону проводимости линейно поляризованной